Структурный фазовый переход и проявление вихревых токов в ИК спектрах отражения полупроводниковых пленок PbSnTe

В.А.Яковлев, А.В.Муратов, И.В.Кучеренко, В.С.Виноградов, Н.Н.Новикова, Г.Карчевски, Ш.Шрайэк

Исследованы температурные зависимости спектров инфракрасного отражения тонких (~60 нм) пленок $Pb_{1-x}Sn_xTe$ с x = 0.25, 0.53 u 0.59, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на гибридных подложках GaAs/CdTe в области 20-5500 см⁻¹ в интервале температур 5-300 К. Из спектров определены температурные зависимости частот поперечных фононов и плазмонов этих пленок, позволившие обнаружить структурный фазовый переход при $T_C \approx 50$ К. Выявлено увеличение плазменных частот с уменьшением ширины запрещенной зоны при охлаждении образца от 300 до 77 К. Увеличение плазменной частоты в основном может быть связано с увеличением концентрации носителей и с переходом их из вихревых токов на поверхности пленки в валентную зону.

Ключевые слова: спектры отражения, дисперсионный анализ, поперечные фононы, фазовый переход, плазменная частота, вихревые токи.

1. Введение

Соединения $A^{IV}B^{VI}$ и сплавы на их основе относятся к узкозонным полупроводникам, кристаллизующимся в разных модификациях в зависимости от состава, давления и температуры. Большое практическое значение имеет тройное соединение свинец–олово–теллур, ширина запрещенной зоны которого зависит от количества олова. Это соединение используется при изготовлении фоторезисторов, фотодиодов, лазеров, работающих в ИК диапазоне в области длин волн 3–40 мкм. В последнее время были созданы лазеры терагерцевого диапазона на основе соединений Pb_{1-x}Sn_xSe ($x \sim 0.14$) с длиной волны излучения 50 мкм.

В твердых растворах PbSnTe и SnTe происходит ферроэлектрический фазовый переход, когда при понижении температуры они переходят из высокотемпературной кубической фазы в низкотемпературную ромбоэдрическую. Теллурид свинца кристаллизуется в кубической структуре и остается таковым вплоть до самых низких температур. Теллурид олова образует кристаллы кубической сингонии, однако при температурах 15–100 К (в зависимости от состава) переходит в ромбоэдрическую модификацию. В кристаллах SnTe с концентрацией дырок 10^{20} см⁻³ фазовый переход происходит при 100 К [1, 2]. С увеличением концентрации носителей р-типа температура фазового перехода понижается [2]. Экспериментальные дан-

В.А.Яковлев, Н.Н.Новикова Институт спектроскопии РАН, Россия, 108840 Москва, Троицк, ул. Физическая, 5; e-mail: novik@isan.troitsk.ru

S.Schreyeck. Physikalisches Institute, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, Germany

Поступила в редакцию 3 февраля 2020 г.

ные [3,4] показывают, что на температуру фазового перехода оказывают влияние как концентрация олова в сплаве, так и концентрации свободных носителей.

При уменьшении температуры твердого раствора происходит относительное смещение подрешеток Pb и Te, которое приводит к уменьшению («смягчению») частоты поперечного фонона [5]. В соединениях PbSnTe возникает сильная связь между межзонными электронными возбуждениями и поперечными колебаниями решетки, что приводит к перенормировке частоты поперечного оптического (transverse optical, TO) фонона. Из теории электронфононного взаимодействия, развитой в работах [1,6-8], следует, что свободные носители оказывают влияние на частоту ТО фонона (vTO) через параметр этого взаимодействия, а именно логарифм суммы $E_{\rm g}$ + $2E_{\rm F}$, где $E_{\rm g}$ – ширина запрещенной зоны; E_F – энергия Ферми [6,7]. Согласно экспериментальным данным [7], частота v_{TO} увеличивается при увеличении $E_{\rm g}$ + 2 $E_{\rm F}$. Ширина запрещенной зоны в твердых растворах Pb_{1-x}Sn_xTe зависит от их состава и температуры и определяется следующим выражением [9, 10]:

$$E_{\rm g}(x,T) = 0.19 - 0.543x + 4.5 \times 10^{-4} \frac{T^2}{T+50}$$
 [9B]. (1)

Однако формула (1) применима лишь к сплавам с $x \le 0.42$ [11]. При большей концентрации олова формула (1) несправедлива и, согласно [12], для x = 0.5-0.6 инверсия зон происходит при T < 80 К.

Недавно методом фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением [12] были исследованы поверхностные состояния с дираковским спектром в тонких пленках $Pb_{1-x}Sn_xTe$ с x = 0.7, которые можно отнести к классу топологических изоляторов (ТИ) при T < 80 К. Согласно [12], вероятность обнаружения этих состояний тем больше, чем больше концентрация олова в сплавах. При x = 0.25 ширина запрещенной зоны, согласно формуле (1), остается положительной вплоть до самых низких температур и $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te$ топологических свойств не прояв-

А.В.Муратов, И.В.Кучеренко, **В.С.Виноградов**. Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Россия, 119991 Москва, Ленинский просп., 53

G.Karczewski. Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, PL-02668 Warsaw, Poland

ляет. Заметим, что зонная структура сплавов с x = 0.5-0.6плохо изучена, однако, согласно [12], при T < 80 К зоны инвертируются и E_g увеличивается по модулю, но является отрицательной величиной. Таким образом, образцы с x = 0.53 и 0.59 можно отнести к классу топологических изоляторов только при T < 80 К.

Особый интерес вызывает существование вихревых токов на поверхности узкозонных полупроводников, теория этого явления была развита В.С.Виноградовым [13]. Теоретически установлено, что в плоских однородных структурах двухзонных полупроводников при любом знаке $E_{\rm g}$ могут существовать спин-поляризованные вихревые состояния с линейным законом дисперсии. Эти состояния привязаны к поверхности и имеют полный момент количества движения, равный 1/2.

В настоящее время проявляется большой интерес к TU, основными свойствами которых является наличие в их спектре спин-поляризованных, линейных по импульсу токовых состояний. При определенных условиях такие состояния возникают на поверхности раздела между полупроводником и вакуумом и представляют собой вихревые состояния. Если поверхность однородна, то вихри возникают в любой ее точке. В дальнейшем мы используем эту теорию для объяснения наблюдаемого нами необычного явления, связанного с увеличением плазменной частоты с уменьшением ширины запрещенной зоны при охлаждении образца.

Отметим, что электронные и фононные свойства в объеме пленок с x > 0.2 изучены мало, а ИК спектры отражения для таких тонких пленок ранее не измерялись. Единственной работой, в которой исследуется ИК отражение сплава $Pb_{1-x}Sn_xTe$ с x = 0.2, легированного In, является статья [4], где частота поперечной моды определялась из функции потерь.

В связи с этим целью настоящей работы было исследование температурных зависимостей мягкой поперечной колебательной моды фононов и определение температуры структурного фазового перехода в пленках $Pb_{1-x}Sn_xTe c x > 0.2$ методом ИК отражения, а также изучение температурной зависимости плазменной частоты при уменьшении ширины запрещенной зоны в пленках $Pb_{1-x}Sn_xTe$ разного состава при их охлаждении.

2. Образцы и методика измерений

Тонкие пленки $Pb_{1-x}Sn_x$ Те были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии из чистых источников Pb, Sn и Te в вакууме (10⁻¹⁰ Top) на подложках (001) GaAs. Перед эпитаксиальным ростом пленок на подложку осаждался буферный слой CdTe. Постоянные решеток пленок и буферного слоя близки по величине: $a_{PbTe} = 6.461$ Å, $a_{CdTe} = 6.481$ Å. Концентрация олова в пленках, определяемая методом рентгеновской дифракции, составляла 25%, 53% и 59%, их толщина была равна 50–60 нм.

Спектры отражения пленок $Pb_{1-x}Sn_xTe$ измерялись при падении света, близком к нормальному, в диапазоне частот 20–5500 см⁻¹ в интервале температур 5–300 К с помощью фурье-спектрометра Bruker IFS 125HR (разрешение 2–4 см⁻¹). При измерениях в дальнем ИК диапазоне в качестве детектора использовался охлаждаемый жидким гелием кремниевый болометр HDL-5 (Infrared Laboratories Inc.). Измеренные спектры нормировались на спектр отражения золотого зеркала. В среднем ИК диапазоне (400–5500 см⁻¹) был использован неохлаждаемый пироэлектрический детектор DLaTGS. Образец помещался в гелиевый криостат CryoVac KONTI Spectro A с возможностью автоматизированного перемещения в вакууме вставки с холодным пальцем, имеющим две одинаковые апертуры для эталонного зеркала и образца. Измерения отражения от образца и зеркала осуществлялись друг за другом при одной и той же температуре.

3. Результаты и их обсуждение

Были измерены спектры отражения трех пленок $Pb_{1-x}Sn_xTe$ с x = 0.25, 0.53 и 0.59 . В образце с x = 0.25 энергетический спектр не инвертирован вплоть до самых низких температур (волновые функции носителей р-типа для зоны проводимости и валентной зоны имеют симметрии L_6^- и L_6^+ соответственно). Ширина запрещенной зоны в этом образце равна 0.17 эВ при T = 300 К и уменьшается с понижением температуры. Как было упомянуто выше, согласно [11] структуры с x = 0.5-0.6 можно отнести к классу ТИ при T < 80 К, поскольку при данных температурах зоны инвертируются и E_g увеличивается.

На рис.1 приведены спектры отражения образцов с x = 0.25 и 0.53 при разных температурах. Видны три полосы, соответствующие поперечным фононам подложки GaAs (268 см⁻¹), буферного слоя CdTe (140 см⁻¹) и пленки (35 см⁻¹). Частоты TO фононов указаны для T = 300 К. Погрешность в измерении частот v_{TO} составляла ~20%. Кроме того, в области 350–600 см⁻¹ видны три слабые полосы, которые мы относим к колебательным модам окисла олова [14]. Как видно из рис.1, частоты TO фононов CdTe и GaAs увеличиваются с понижением температуры.

С помощью дисперсионного анализа спектров отражения и программы SCOUT [15, 16], получены параметры оптических фононов и плазмонов. В табл.1 приведены толщины пленок *d*, высокочастотные диэлектрические



Рис.1. Спектры отражения пленок $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te(a)$ и $Pb_{0.47}Sn_{0.53}Te(\delta)$, измеренные при разных температурах.

Γ						
<i>d</i> (нм)	ε _∞	v_{TO} (cm ⁻¹)	$v_{\rm LO} ({\rm cm}^{-1})$	<i>v</i> _{pl} (см ⁻¹)	$n (10^{17} \text{ cm}^{-3})$	$\tau (10^{-14} \text{ c})$
65	38	35.7	107	213	7.9	0.5
85	37.5	41	140	206	7.6	2.6
57	38	49	-	775.6	85	1.7
	<i>d</i> (нм) 65 85 57	$ \begin{array}{r} d(\text{HM}) & \varepsilon_{\infty} \\ \hline 65 & 38 \\ 85 & 37.5 \\ 57 & 38 \\ \end{array} $	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	d (HM) ε_{∞} v_{TO} (cm ⁻¹) v_{LO} (cm ⁻¹) 65 38 35.7 107 85 37.5 41 140 57 38 49 -	d (HM) ε_{∞} v_{TO} (CM ⁻¹) v_{LO} (CM ⁻¹) v_{pl} (CM ⁻¹) 65 38 35.7 107 213 85 37.5 41 140 206 57 38 49 - 775.6	d (HM) ε_{∞} v_{TO} (cm ⁻¹) v_{LO} (cm ⁻¹) v_{pl} (cm ⁻¹) n (10 ¹⁷ cm ⁻³)653835.71072137.98537.5411402067.6573849-775.685

Табл.1. Параметры пленок $Pb_{1-x}Sn_xTe$ при T = 300 K.

проницаемости ε_{∞} , частоты поперечных и продольных (longitudinal optical, LO) оптических фононов v_{TO} , v_{LO} , плазменные частоты v_{pl} , концентрации свободных носителей р-типа *n*, времена их релаксации $\tau = 1/(2\pi c v_{\tau})$ при 300 К (v_{τ} – частота их столкновений).

На рис.2 показаны температурные зависимости квадрата частоты TO фонона (v_{TO}^2) пленок Pb_{1-x}Sn_xTe c x = 0.25 и 0.53. Из рис.2, а видно, что частота v_{то} изменяется незначительно, в пределах 37-35.3 см⁻¹, в интервале температур 77-300 К. При *T* < 77 К частота ТО фонона резко увеличивается, что, как мы полагаем, связано со структурным фазовым переходом образца в ромбоэдрическую фазу. Температура фазового перехода лежит в интервале 77-50 К. Согласно теории [6,7], температурная зависимость v²_{TO} определяется взаимодействием межзонных возбуждений и поперечных колебательных мод. Параметром, определяющим это взаимодействие, является сумма $E_{\rm g}$ + 2 $E_{\rm F}$. В пленке с x = 0.25 параметр $E_{\rm g}$ уменьшается с понижением температуры, а E_F увеличивается, поскольку, как будет показано ниже, уменьшается эффективная масса свободных носителей. Таким образом, уменьшение E_{g} компенсируется увеличением $E_{\rm F}$, в результате $E_{\rm g}$ + $2E_{\rm F}$ мало изменяется в интервале 77-300 К. На вставке рис.2,а приведена температурная зависимость $1/\varepsilon_s$, где ε_s – статическая диэлектрическая проницаемость. Из этой зависи-



Рис.2. Температурная зависимость v_{TO}^2 в пленках Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te (*a*) и Pb_{0.47}Sn_{0.53}Te (δ). На вставке – температурная зависимость $1/\epsilon_s$, где ϵ_s – статическая диэлектрическая проницаемость. Погрешность в измерении v_{TO} составляла ~20 %.

мости мы определили температуру Кюри: $T_{\rm C} \approx 49$ K, что находится в удовлетворительном согласии с температурой фазового перехода в этой пленке. В пленке с x = 0.53 частота TO фонона уменьшается с понижением температуры (см. рис.1), температурная зависимость $v_{\rm TO}^2$ в интервале 77–200 K (рис.2, δ) описывается линейной функцией, экстраполяция которой дает температуру фазового перехода $T_{\rm C} \approx 50$ K.

Мы обнаружили, что плазменная частота $v_{\rm pl} = v_{\rm p}/\sqrt{\varepsilon_{\infty}}$ (где $v_{\rm p} = [ne^2/(\pi m_{\rm c}^*)]^{1/2}$ – плазменная частота свободных носителей, $m_{\rm c}^*$ – эффективная масса носителей) во всех пленках увеличивается при понижении температуры (рис.3), причем отношение квадратов частот $v_{\rm pl}^2$ для температур 77 и 300 K равно 2.6 ± 0.1.

Неожиданным и требующем объяснения фактом является сильная зависимость от температуры частоты плазменных колебаний, когда $v_{\rm pl}^2$ увеличивается почти в три раза при понижении температуры от 300 до 77 К. Она может определяться зависимостями от температуры величин ε_s, m_c^* и *n*. Рассмотрим эти возможности. Статическая диэлектрическая проницаемость сильно зависит от температуры через частоту поперечных оптических колебаний *v*_{TO}. Однако плазмоны наблюдаются при значительно большей частоте, чем v_{TO}, когда диэлектрическая проницаемость не зависит от температуры и приближается к высокочастотной диэлектрической проницаемости ε_{∞} . В полупроводниках с дираковским электронным спектром в изотропном приближении эффективную массу можно описать следующей формулой: $m_{\rm c}^* = (\Delta^2 + v^2 p_{\rm F}^2)^{1/2} / v^2$, где $\Delta = E_{\rm g}/2$ – параметр щели, $v \approx 10^8$ см/с – скорость электронов, $p_{\rm F} = \hbar (3\pi^2 n)^{1/3}$ – импульс на границе Ферми. Масса $m_{\rm c}^*$ зависит от температуры через параметр Δ . Наиболее сильно $m_{\rm c}^*$ зависит от Δ на дне зоны, когда $p_{\rm F} \rightarrow 0$. В этом случае отношение $r = m_c^*(T_2)/m_c^*(T_1)$ (при $T_1 = 70$ К, $\Delta(T_1)$ = 0.5×90 мэВ, T_2 = 300 К и $\Delta(T_2)$ = 0.5×170 мэВ) составляет ~1.9. В том случае, когда $p_F \neq 0$ и $n \approx 0.3 \times 10^{18}$ см⁻³, отношение $r \approx 1.12$. Если же $n \approx 10^{18}$ см⁻³, то $r \approx 1.06$. Приведенные выше соображения и оценки позволяют заключить, что две первые возможности наблюдаемую зависимость не объясняют. Остается третья - зависимость



Рис.3. Температурные зависимости плазменных частот v_{pl} в пленках $Pb_{1-x}Sn_x$ Те для x = 0.25, 0.53 и 0.59.



Рис.4. Функции потерь Im[$-1/\epsilon(v)$] в пленках Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te (*a*) и Pb_{0.47}Sn_{0.53}Te (*б*) при разных температурах.

n(T). Для ее реализации в полупроводнике должна существовать система, в которую могли бы переходить свободные носители с достаточным числом состояний и возбуждениями, отличными от плазмонов. Подходящими свойствами обладает система вихрей [13], которые возникают на поверхности раздела двух сред с сильно различающимися значениями параметра спин-орбитального взаимодействия (полупроводников или полупроводника и вакуума, как в нашем случае). Так же как и для поверхностных состояний, для них характерен линейный закон дисперсии, но, в отличие от первых, не требуется инверсия параметра щели. Вихрь возникает в любой точке однородной плоскости. Его волновая функция спадает экспоненциально от центра вихря во всех азимутальных направлениях, параллельных плоскости, и распространяется как плоская волна внутрь полупроводника. Подсчитаем число состояний совокупности вихрей. Число вихрей на единицу площади равно $1/\pi R^2$, где $1/R = \Delta/\hbar v$, R – радиус вихря. Число состояний n_v, распределенных по зоне в полупроводнике перпендикулярно плоскости раздела (направление z), подсчитывается стандартным образом, как для свободных электронов. Учитывая линейный закон дисперсии $\varepsilon(k_z) = vk_z$, получаем $n_v = \Delta^2 \varepsilon_F / (2\pi^2 \hbar^3 v^3)$. Считается, что все вихри имеют одно и то же направление спина. Для числа состояний свободных носителей с учетом двух направлений спина получим $n_{\rm f} = (\varepsilon_{\rm F}^2 - \Delta^2)^{3/2} / (3\pi^2 \hbar^3 v^3)$. В формулах для n_v и n_f энергия отсчитывается от центра щели. Число носителей в зоне и в вихревых состояниях выравнивается при $\Delta / \varepsilon_{\rm F} \approx 0.59$. При уменьшении этого параметра число носителей в зоне становится большим, чем в вихревых состояниях. Во всех исследованных пленках данный параметр составляет ~ 0.5 при T = 300 K и уменьшается с уменьшением ширины запрещенной зоны. Таким образом, переход носителей из вихревых состояний в разрешенную зону пленки возможен.

На рис.4 приведены температурные зависимости функций потерь Im($-1/\varepsilon$) в пленках с x = 0.25 и 0.53. Максимумы этих функций соответствуют частотам плазмон – LO фонон гибридных мод (положительные ветви). Видно, что с понижением температуры функции потерь смещаются в высокочастотную область из-за увеличения плазменной частоты. Из функций потерь можно определить частоты LO фононов, которые при T = 300 К составляют 107 см⁻¹ в пленке с x = 0.25 и 140 см⁻¹ в пленке с x = 0.53 (табл.1). Зная v_{TO} , v_{LO} и ε_{∞} в интервале температур 77–300 К и используя соотношение Лиддейна – Сакса – Теллера, мы рассчитали температурную зависимость $1/\varepsilon_s$ для пленки Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te (см. вставку на рис.2). Температура Кюри в этом образце составляет 49 К, что согласуется с температурой структурного фазового перехода в этой пленке.

4. Заключение

Таким образом, впервые из измерений ИК спектров отражения определены температурные зависимости параметров фононов и плазмонов в пленках $Pb_{1-x}Sn_xTe$ с x > 0.2, позволившие обнаружить структурный фазовый переход при $T_C \approx 50$ К. Во всех исследуемых пленках плазменная частота увеличивается при уменьшении ширины запрещенной зоны с понижением температуры. Этот результат частично связан с уменьшением эффективной массы носителей, но, главным образом, с ростом концентрации носителей за счет возникновения вихревых токов на поверхности пленок и с переходом их из вихревых состояний в валентную зону.

Работа выполнена при поддержке крупного проекта «Фотонные технологии в зондировании неоднородных сред и биообъектов» (проект «ИК спектроскопия поляритонов нанопленок в дальнем и ближнем поле»). Исследования в Польше были частично поддержаны грантами № 2017/25/B/ST3/02966 и 2018/30/M/ST3/00276. Исследования в Германии были частично поддержаны грантом SFB 1170 'ToCoTronics'.

- Sugai S., Murase K., Katayama S., et al. *Solid State Commun.*, 24, 407 (1977).
- Kabayashi K.L.I., Kato Y., Katayama Y., Komatsubara K.F. Phys. Rev. Lett., 37, 772 (1976).
- 3. Nishi S., Kawamura H., Murase K. *Phys. Stat. Sol.* (*b*), **97**, 581 (1980).
- Белогорохов А.И., Белов В.Г., Неизвестный И.Г. и др. ЖЭТФ, 92, 869 (1987) [Sov. Phys. JETP, 65, 490 (1987)].
- Alperin H.A., Pickert S.T., Rhyne J.J., Minkiewicz V.J. *Phys. Lett.*, 40A, 295 (1972).
- Kawamura H., Katayama S., Takano S., Hotta S. Solid State Commun., 14, 259 (1974).
- Kawamura H., Muraze K., Nishikawa S., et al. Solid State Commun., 17, 341 (1975).
- Волков Б.А., Панкратов О.А. ЖЭТФ, 75, 1362 (1978) [Sov. Phys. JETP, 48, 687 (1978)].
- Akimov B.A., Dmitriev A.V., Khokhlov D.R., Ryabova L.I. *Phys. Stat. Sol. (a)*, **137**, 9 (1993).
- Dimmock J.O., Melngailis I., Strauss A.J. Phys. Rev. Lett., 16, 1193 (1966).
- 11. Ferreira S.O., Abramof E., et al. J. Appl. Phys., 86, 7198 (1999).
- Chenhui Yan, Junwei Liu, Yunyi Zang, Jianfeng Wang, et al. *Phys. Rev. Lett.*, **112**, 186801 (2014).
- 13. Виноградов В.С. Кр. сообщ. физ. ФИАН, № 2, 40 (2019).
- 14. Summitt R. J. Appl. Phys., 39, 3762 (1968).
- 15. Theiß W. The SCOUT through CAOS, Manual of the Windows application SCOUT.
- 16. Theiß W. Surf. Sci. Reports, 29, 91 (1997).